自然科学・工学-健康・医療:1年助成

# 短受検時間・低被曝線量な光子計数型 X 線 CT 用 新構造シリコン X 線センサーの創製

有吉 哲也 福岡工業大学 准教授

## Development of a new structure silicon X-ray sensor for photon counting type X-ray CT with short inspection time and low radiation dose

Tetsuya Ariyoshi, Fukuoka Institute of Technology, Associate Professor



光子計数型 X 線 CT スキャナ用のシリコン X 線光子センサーを研究している。X 線光子検出効率及び応答時間 を改善するために、半導体加工技術を応用して PN 接合シリコンフォトダイオードをトレンチ(溝)状に形成す る。試作した長さ 20 mm のセンサーに 60 keV の y 線光子を照射したところ検出信号を観測することに成功した。 信号電荷を損失なく収集でき、ナノ秒に迫る信号立ち上がり時間を達成でき、X 線光子センサーとしての要素技 術を構築した。

Silicon X-ray photon sensors for photon-counting X-ray CT (Computed Tomography) scanner were studied. This silicon material is inexpensive and has excellent processability. To improve X-ray photon detection efficiency and response time, PN-junction silicon photodiodes are formed in a trench shape by applying semiconductor processing technology. The fabricated 20 mm-long sensor was irradiated with 60 keV  $\gamma$ -ray photons used in the photon-counting CT scanner, and the detection pulse signal was successfully observed. The signal charge generated by photoelectric conversion could be collected without loss, and signal rise time approaching nanoseconds level could be achieved. We have developed the elemental technology as an X-ray photon sensor.

### 1. 研究目的

物体識別や物体内の構造解析や物質の元素分析 などの非破壊検査で、我々は光を利用している。 ここでいう「光」とは可視光線はもちろん、赤外 線やX線などの不可視光も含める。特に、透過力 があり放射線の一種であるX線は健康診断でレン トゲン写真撮影として広く利用されており、身近 である。また、物体や人体の断面像を得るCTス キャナもX線が利用されている。従来ではこのX 線の強度情報のみ利用されて像は濃淡のみであっ たが、近年はX線の光量子(光子)のエネルギー 情報も活用して、撮像画素毎に元素濃度マッピン グを得る光子計数型 X 線 CT スキャナの開発が行 われている。この方式ではまた、閾値を超えた X 線光子のみを計測するので、従来型の CT スキャ ナと比べて検出器の暗電流の影響を避けることが できる。よって高 SN 比が実現でき、余計な X 線 の照射を抑えることができ、被曝線量の低減にも 貢献する。情報量が多い元素濃度マッピング CT 像を得るためにはナノ秒レベルの X 線光子検出信 号を得て、1000 万カウント/秒以上の X 線光子計 数率を有する X 線光子検出器が求められる。実現 すれば短受検時間及び従来比で一桁以上少ない被 曝線量での CT スキャナが実現でき、被験者の負 担軽減となる。本研究では無害で加工が容易で安 価で高いキャリア移動度寿命積を示すシリコン材 料を用いて新構造のX線光子検出器を提案する。 具体的な目的として、シリコン基板中に PN 接合 シリコンフォトダイオードをトレンチ(溝)状に 形成し、センサー基板の側面方向から y (X) 線光 子を照射し、応答特性を評価する。

#### 2. 提案するシリコン X 線光子センサー

X線は透過力があるので人体や物体の内部構造 のイメージングができるが、別の見方をすると、 透過力があるが故に、センサーで効率よくX線を 検出することが課題である。シリコンは上述の通 り無害で加工が容易で安価で高いキャリア移動度 寿命積を示す有用な検出器材料である。しかし、 唯一の問題点として原子番号が低く、通常のイ メージセンサー用 PN 接合シリコンフォトダイ オードでは光子計数型 CT スキャナで利用される 硬X線は検出されにくく、検出効率が1%以下と 低い。そこでこの問題を解決すべく、図1に新た な高検出効率X線光子検出器として提案するトレ ンチ(溝)構造型シリコンフォトダイオードの概 略図及び試作した素子の断面 SEM (走査型電子顕 微鏡)写真を示す。

半導体加工技術を応用し、PN 接合シリコンフォ トダイオードをトレンチ(溝)状に形成して、数 十ボルト程度の低い印加逆バイアス電圧にて実効 的な X 線有感領域(空乏領域)をセンサー中に広 げ、センサー基板の側面方向から X 線を照射する ことで検出効率を 80%以上に改善できる。先の研 究では抵抗率 1500±500 Ωcm の FZ シリコンウエハ 基板中に作製するトレンチフォトダイオードの奥行 きの長さを 20 mm、印加逆バイアス電圧を – 20 V として、管電圧 80 kV の X 線に対して 83.8%の X 線-信号電流変換効率を達成している[1]。

#### 3. y(X)線光子検出実験

信号処理回路系として図2に示すような、単一 X線光子検出パルスを検出できるように帰還容量 C<sub>f</sub>を備えた電荷増幅器系をプリント基板上に製作 した。試作したX線センサーをこのプリント基板 上に実装し、法規制対象外の強度 I=8 kBg で 60 keVのy線光子を放出する<sup>241</sup>Am線源を用いて光 子検出信号を評価する。図3に、その幾何学的関 係を示す。センサー長Lは20mm、センサー開口 面積 2a×2b は 120 µm×300 µm、線源とセンサー 間距離 d<sub>0</sub>は 1.5 mm、使用した円板型線源の半径  $R_s$ は1.2 mm であった。電荷増幅器の帰還容量を 25 fF、センサーに印加する逆バイアス電圧を-20 Vとしたところ、図4に示すような60keVのy線 光子検出パルス波形を電荷増幅器にて観測した。 波高値は104 mV であり、理論予測の107 mV と ほぼ一致し、y線光子による光電変換電荷を損失 なく収集することを実証した。また、電荷収集時



図 1. 提案するトレンチ (溝) 状 PN 接合型シリコンフォトダイオード 左図:概略図、右図:断面 SEM (走査型電子顕微鏡) 写真



図 2. y(X)線光子検出用信号処理回路



 $\gamma$ -ray radiation source ( $\varphi$ =2 $R_s$ )

図 3. 試作センサーと y (X) 線源との幾何学的関係図



図 4. 60keV の y 線光子検出パルス波形の観測

間に比例する信号立ち上がり時間は 12 ns であり、 本提案センサーは光子計数型 CT スキャナ用の X 線光子検出器として高速で、目標とする光子計数 率 1000 万カウント/秒を達成できる可能性も実証 した。 自然科学・工学-健康・医療:1 年助成

線源の強度 I、  $\gamma$ 線放出確率 P、線源がセンサー 入射窓(開口部)を見込む立体角  $\Omega$  (l)[2]、素子 中のトレンチ部の割合  $v_{trench}$ 、線減弱係数  $\mu$ 、セン サー長 L、とすると、試作センサーの  $\gamma$  (X) 線の計 数率 r は、以下のようになる。

$$r = I \cdot P \cdot (1 - v_{trench}) \cdot \frac{1}{4\pi} \int_0^L \Omega(l) \cdot \exp(-\mu l) \cdot \mu dl$$

この $\gamma(X)$ 線計数率rの理論値は $1.07 \times 10^{-1}$  [cps] である。一方、実測値では $1.09 \times 10^{-1}$  [cps] とい う結果となり、両者で近い値となった。以上の各 実験によって試作センサーは $\gamma(X)$ 線光子を正常に 検出・計数していることが実証された。但し、今 回は法規制外の弱い線源を用いての実験だったの で、より強度の高い線源を用いての評価が必須で ある。

今後の課題として、得られた y 線光子検出パル スの立ち上がり時間 12 ns の理論的裏付け、及び、 より高速に生成電荷を収集できる素子構造を検討 する。また、画素間に溝を掘り、画素中に生成し た信号電荷が隣接画素に漏出することを防ぎ、画 像のにじみを抑制するセンサー構造も検討する。 以上はプロセスデバイスシミュレーションにて検 証可能とされ、その評価結果をもとに実際のセン サーを試作していく。

#### 参考文献:

- [1] T. Ariyoshi, Y. Takane, J. Iwasa, K. Sakamoto, A. Baba, and Y. Arima, "Silicon trench photodiodes on a wafer for efficient X-ray-tocurrent signal conversion using side-X-rayirradiation mode," Jpn. J. Appl. Phys., vol. 57, no. 4S, pp. 04FH04-1~04FH04-6, Mar. 2018.
- [2] N. Tsoulfanidis and S. Landsberger, Measurement and Detection of Radiation, 5th ed. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2021.

### 4. 発表(研究成果の発表)

(1) T. Ariyoshi, "Response Properties of Silicon

Trench Photodiodes to Single  $\alpha$ - and  $\gamma$ -Ray in Pulse Mode", IEEE Access, vol. 10, pp. 56218–56231, 2022.

(2) (採択決定) T. Ariyoshi and T. Matsunaga., "Experimental and Simulating Demonstration of Fast Response by Using a Silicon X-ray Photon Sensor", 55th Int. Conf. on Solid State Devices and Materials.